

## 第 21 回高分子分析討論会報告

2016 年 10 月 20 日(木), 21 日(金)の 2 日間, 好天のもと高分子分析研究懇談会主催の第 21 回高分子分析討論会が愛知県名古屋市の名古屋国際会議場白鳥ホールにて開催された。2 日間にわたりポスター発表 93 件の研究発表が行われた。参加者数は 349 名であり, 例年同様大きな規模となった。また, 協賛企業は 25 社を数え, 両日にわたりテクニカルレビューとポスター会場内での実験器具, 各種装置やデータ処理ソフトなどの説明が行われた。今回は第 1 回の討論会から 20 周年の記念となる開催となった。

初日午前中は, 石田康行(中部大学)実行委員長の挨拶による開会の後, 第 1 回の研究発表が行われた。本討論会の研究発表は, 最初に口頭で 2 分半のプレビュー講演を行った後, 1 時間半のポスター発表を行うものである。プレビュー講演の後には, 協賛企業の展示に関して簡単な紹介を壇上で行うテクニカルレビューが行われた。ポスター発表では活発な討論が長時間にわたって交わされ, 会場は熱気にあふれていた。発表内容は, 高分子分析における研究対象の広さから合成高分子, 天然高分子, 添加剤, 界面など, 学問的にも技術的にも幅広く多岐にわたっていた。

初日午後は第 2 回の研究発表が行われた。その後, 特別講演として高分子分析研究懇談会発足当時より会の発展にご尽力いただいたスペクトラ・フォーラム代表高山森氏より「高分子分析討論会 20 年の歩みを未来志向で振り返る」と題してご講演いただいた。高分子分析研究懇談会は「give and take」の場であること, 研究発表の場である高分子分析討論会では間口を広くとり, 事前の口頭説明の後にポスター発表という発表形式にしたこと, 要旨を 2 頁と多くしたことなど, 発足当時から現在まで続いている懇談会, 討論会の理念を説明された。その後, 過去 20 回の討論会の発表全件(1450 件余り)の内容について分析し, 「間口の広さ」, 「発表方法や要旨集は効果的だったか」, 「討論会開催の意義」, 「討論会はこの先も順風満帆か」について検証された。さらに, 発表内容をもとに「分析装置や解析手法の進歩」, 「検証実験の貴重さ」, 「化学分析の伝承」, 「生きたサンプルの分析事例を引き出すために」, など多岐にわたる視点から将来への期待と希望を述べられた。夕刻からは同国際会議場内のカスケードにて懇親会が開催され, 討論会参加者の半数近い約 160 名に参加いただき, 盛況のうちに初日を終了した。

2 日目午前には第 3 回, 午後より第 4 回の研究発表が行われた。その後, 総合講演「高分子分析の次の 10 年 さらなる一歩」が開催された。総合講演が行われたのは第 11 回討論会以来 10 年ぶりであった。石田実行委員長の司会により, 菅沼こと氏(帝人), 佐藤崇文氏(日本電子), 本多貴之氏(明治大学), 松山重倫氏(産業技術総合研究所)をパネラーとして, 前日に参加者から募ったアンケートをもとに 50 分間のパネルディスカッションが行われた。前半のテーマ「技術の継承」については, 多くの参加者が困難さを感じており, 継承すべき技術の明確化, 人材確保のために分析は魅力ある重要な分野であることを若い研究者, 社内の他部署や経営陣など多方面にアピールする必要があること, 開発部署と共に分析に付加価値を与えること, などが提示された。後半のテーマ「10 年後のブレークスルー」については, 分析技術複合化の多様化, 多方面の異なるアプローチからの解析, 既存手法のブラッシュアップ, 企業間のコラボレーション, などについて活発な討論がなされた。

一般研究発表に対する表彰として, 審査委員の選考による「審査委員賞」4 件, 参加者全員の投票による「ポスター賞」4 件をそれぞれ(ともに初日と 2 日目で 2 件ずつ)選出し, 受賞者には懇親会および閉会時に賞状と副賞が授与された。受賞した演題と演者を以下に記した。

### ◆審査委員賞

「SBF-SEM 法によるジブロックコポリマーの三次元再構築」山口 祐樹 (日本電子)

「赤外 pMAIRS 法によるシランカップリング処理基板上のポリチオフェン膜の分子配向解析」安孫子 勝

寿 (豊田中央研究所)

「MALDI-MS イメージングを用いたポリプロピレン中の光安定剤分析」端崎 里帆 (名古屋工業大学)

「ヘテロダイン検出振動和周波発生法による含フッ素ポリマーの界面配向解析」本間 脩 (AGC 旭硝子)

◆ポスター賞

「高分解能 MALDI-MS および熱分解分析法によるテトラエトキシシランの重合反応過程の解析」佐藤 咲也子 (名古屋工業大学)

「タッピング型走査プローブエレクトロスプレーイオン化法によるフィルム印刷物の質量分析イメージング」小東 剛 (関西大学)

「NMR 法による水素化ポリブタジエンの長鎖分岐点構造の直接解析」石井 悠也 (UBE 科学分析センター)

「2次元 LC-MALDI/TOFMS 法によるポリエーテルポリオール of 包括的構造解析」柿内 俊文 (AGC 旭硝子)

来年度は、第22回高分子分析討論会を茨城県のつくば国際会議場にて10月12日(木)・13日(金)の2日間にわたり開催します。

最後に、本会の開催にあたり、企業協賛いただいたi-NEAT(株)、旭テクネイオン(株)、アジレント・テクノロジー(株)、伊勢久(株)、インフォコム(株)、エーエムアール(株)、(株)エス・ティ・ジャパン、(株)カモソフトウェアジャパン、(株)KRI、(株)ケーワイエーテクノロジーズ、サーモフィッシャーサイエンティフィック(株)、(株)島津製作所、昭和電工(株)／Shodex®、(株)住化分析センター、(株)デジタルデータマネジメント、東ソー(株)、日本ウォーターズ(株)、日本電子(株)、日本分光(株)、日本分析工業(株)、(有)ヒューズ、フロンティア・ラボ(株)、ライカマイクロシステムズ(株)、(株)リガク、LECO ジャパン合同会社の各社に深く感謝いたします。

[星光 PMC(株) 伊藤賢一]